



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204977643 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201520670221. X

(22) 申请日 2015. 08. 31

(73) 专利权人 陈巧琴

地址 213105 江苏省常州市武进区洛阳镇天
井村常州市昌隆彩印有限公司

(72) 发明人 陈巧琴

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

B32B 15/082(2006. 01)

B32B 15/085(2006. 01)

B32B 15/20(2006. 01)

B32B 7/10(2006. 01)

B32B 25/08(2006. 01)

B32B 25/20(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)

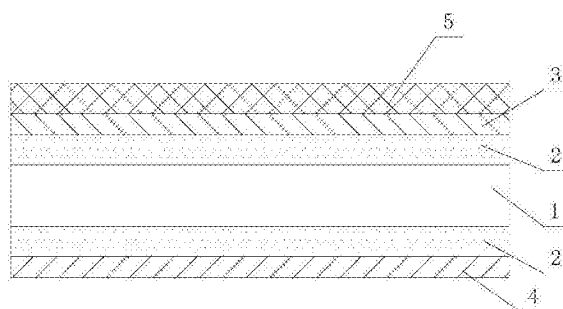
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

抗紫外线泡罩铝膜

(57) 摘要

本实用新型涉及药用包装材料技术领域,尤其是一种抗紫外线泡罩铝膜。这种抗紫外线泡罩铝膜,包括铝箔基体,铝箔基体上方设有涂覆有紫外线吸收剂的聚酯薄膜层,铝箔基体下方设有聚氯乙烯层,所述铝箔基体和聚酯薄膜层之间粘合有复合胶层,铝箔基体聚氯乙烯层之间粘合有复合胶层;所述聚酯薄膜层外表面粘合有保护层。本实用新型结构简单,设计合理,美观、耐压、复合附着力大、复合紧密、不起泡、不破裂、强度大,同时具有良好的抗紫外线性能。



1. 一种抗紫外线泡罩铝膜,其特征在于:包括铝箔基体(1),铝箔基体(1)上方设有涂覆有紫外线吸收剂的聚酯薄膜层(3),铝箔基体(1)下方设有聚氯乙烯层(4),所述铝箔基体(1)和聚酯薄膜层(3)之间粘合有复合胶层(2),铝箔基体(1)聚氯乙烯层(4)之间粘合有复合胶层(2);所述聚酯薄膜层(3)外表面粘合有保护层(5)。

2. 根据权利要求1所述的抗紫外线泡罩铝膜,其特征在于:所述的保护层(5)为硅酮处理保护膜。

3. 根据权利要求1所述的抗紫外线泡罩铝膜,其特征在于:所述的抗紫外线泡罩铝膜的厚度为0.08-0.12mm。

抗紫外线泡罩铝膜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药用包装材料技术领域,尤其是一种抗紫外线泡罩铝膜。

背景技术

[0002] 复合软包装工业是在 20 世纪中叶开始发展起来的,而且愈来愈显示出它在医药包装方面的重要性,这类易撕膜由基材、层合胶粘剂、阻隔材料、热封材料、印刷与保护层涂料等组成。药品属于高要求的产品,因此对包装材料的要求极高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种抗紫外线泡罩铝膜。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种抗紫外线泡罩铝膜,包括铝箔基体,铝箔基体上方设有涂覆有紫外线吸收剂的聚酯薄膜层,铝箔基体下方设有聚氯乙烯层,所述铝箔基体和聚酯薄膜层之间粘合有复合胶层,铝箔基体聚氯乙烯层之间粘合有复合胶层;所述聚酯薄膜层外表面粘合有保护层。

[0005] 进一步地,所述的保护层为硅酮处理保护膜。

[0006] 进一步地,所述的抗紫外线泡罩铝膜的厚度为 0.08-0.12mm。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,美观、耐压、复合附着力大、复合紧密、不起泡、不破裂、强度大,同时具有良好的抗紫外线性能。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中 1. 铝箔基体,2. 复合胶层,3. 聚酯薄膜层,4. 聚氯乙烯层,5 保护层。

具体实施方式

[0011] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0012] 如图 1 所示的抗紫外线泡罩铝膜,包括铝箔基体 1,铝箔基体 1 上方设有涂覆有紫外线吸收剂的聚酯薄膜层 3,铝箔基体 1 下方设有聚氯乙烯层 4,铝箔基体 1 和聚酯薄膜层 3 之间粘合有复合胶层 2,铝箔基体 1 聚氯乙烯层 4 之间粘合有复合胶层 2;聚酯薄膜层 3 外表面粘合有保护层 5。

[0013] 保护层 5 为硅酮处理保护膜;抗紫外线泡罩铝膜的厚度为 0.1mm。

[0014] 这种抗紫外线泡罩铝膜结构简单,设计合理,美观、耐压、复合附着力大、复合紧密、不起泡、不破裂、强度大,同时具有良好的抗紫外线性能。

[0015] 上述实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技

术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

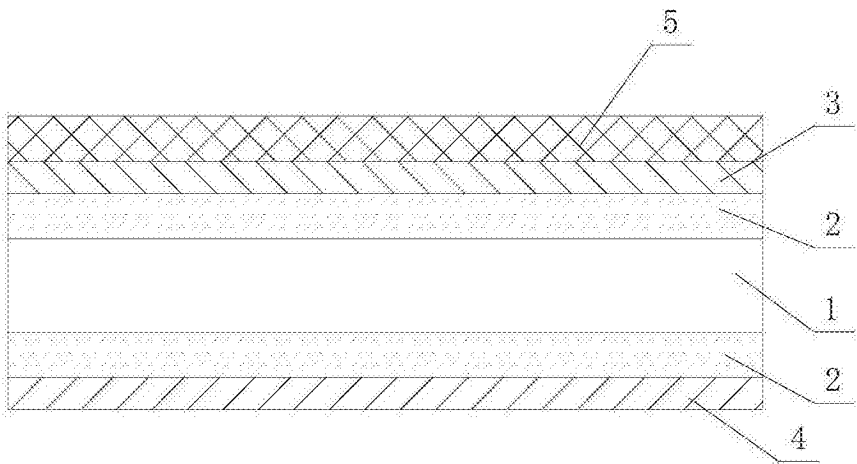


图 1